

*Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків*

### **РОЗРОБКА ПРОЗОРИХ ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ZnO:Al ТА SnO<sub>2</sub>:Sb**

У доповіді наведені результати розробки технології магнетронного розпилення шарів ZnO:Al та SnO<sub>2</sub>:Sb для створення прозорих плівкових електродів. Для цього досліджено вплив фізико-технологічних режимів нереактивного магнетронного розпилення на оптичні та електричні властивості плівок, сформованих на скляних та гнучких поліімідних підкладках.

*Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків*

### **РАЗРАБОТКА ПРОЗРАЧНЫХ ПЛЁНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ZnO:Al ТА SnO<sub>2</sub>:Sb**

В докладе приведены результаты разработки технологии магнетронного распыления слоёв ZnO:Al и SnO<sub>2</sub>:Sb для создания прозрачных плёночных электродов. Для этого исследовано влияние физико-технологических режимов нереактивного магнетронного распыления на оптические и электрические свойства плёнок, сформированных на стеклянных и гибких полиимидных подложках.

*Krikun K.U., Khripunov G.S., Ukraine, Kharkov*

### **THE DEVELOPMENT OF ZnO:Al AND SnO<sub>2</sub>:Sb TRANSPARENT FILM ELECTRODES**

In the report the results of technological development of a magnetron sputtering of layers ZnO:Al and SnO<sub>2</sub>:Sb for creation of transparent film electrodes *are presented*. For this purpose influencing physics-technological modes of a nonreactive magnetron sputtering on optical and electrical properties of films deposited on glass and flexible polyimide substrates is investigated.